

経済産業大臣

萩生田 光 一 殿

一般社団法人日本半導体製造装置協会

会 長 牛 田 一 雄

税制改正に関する要望書

2021 年 4～6 月期における日本の実質 GDP 速報値（1 次速報値）は年率換算で 1.3%増となり、2 四半期ぶりのプラス成長を記録しました。10 月発表の IMF 世界経済見通しでは、2021 年の世界実質成長率が 5.9%と前回予測から 0.1 ポイント引き下げられ、日本の成長率も 2.4%と前回予測から 0.4 ポイント引き下げられました。国際的な税制面では、OECD 加盟国を含む 136 カ国・地域が、法人最低税率 15%の新国際課税ルールで合意し、世界の巨大 IT 企業を取り巻く環境も大きく変わろうとしています。

先端技術を巡る米中の対立は、当初の追加関税を中心とした貿易摩擦から、現在は安全保障に関わる米国の規制強化に至るまで広範囲に及び、早期に融和へ向かう兆しはみられません。半導体は、デジタル社会を支える重要基盤・安全保障に直結する戦略技術として認識され、各国間の競争も更に峻烈さを極めております。既に米国、中国、韓国、台湾、欧州各国は、経済安全保障の観点から半導体産業を重視し、過去にないレベルの産業政策を展開しております。これらには、半導体製品の競争力強化だけでなく、自国の半導体製造装置の競争力強化と内製化率を高める動きが含まれています。

現在日本製半導体・FPD 製造装置の世界シェアは 3 割程度となっており、殆ど国内に生産拠点を有し、国内の雇用を維持しながら、輸出比率 8 割を達成しております。昨年度の日本半導体製造装置の販売高は、前年同期比 15%増と高い伸びを記録しましたが、世界全体の伸び 19%増（2020 年 CY）に比べると、やや低い水準にとどまっています。

当業界は技術革新が著しい産業であり、これからも日本企業がグローバル競争に打ち勝つためには、絶え間ない最先端技術の研究・開発によるイノベーションの創出が必要不可欠です。現在、日本の半導体製造装置メーカーの売上高比研究開発費は平均して 10%程度となっております。日本の製造業の中では相対的に高い水準ですが、世界的な半導体製造装置企業に比較すると 10%程度では決して高い水準とは言えないのが実情です。

ロジック半導体を例にとると、既に世界的な研究機関から 2031 年に至る技術ロードマップが示されております。今後数年でトランジスタの構造と使われる材料が大きく変化してゆく見込みです。世界中の半導体製造装置メーカーが、その構造と材料の変化に合わせて、高度な開発を行っております。半導体産業は、今まさに技術の変曲点を迎えつつあり、研究開発費につきましては、ここ数年で更なる上昇が予想されております。技術の大きな変化タイミングでは、持続的に高い先行開発費を負担できるかどうか、企業の産業競争力を決定します。現在 5nm プロセスに採用され脚光を浴びている EUV（極端紫外線）露光

技術ですが、歴史を辿ると実際の開発開始から量産適用までには、10 数年を要しています。

今こそ半導体製造装置業界には、税制面を中心として持続的な研究開発費の先行負担に見合った手厚い政策サポートが必要です。売上高比研究開発費が現在の 10%から 20%程度に上昇しても国際競争力を保ち、国内に生産・開発拠点を維持してゆくためにも、以下に挙げた項目の税制改正を強く要望致します。

1. 研究開発促進税制の拡充と見直し

半導体・FPD 製造装置産業の売上高研究開発費率は 9.34%^{※1} と、全産業平均の 4.02%^{※2}、製造業平均の 4.83%^{※2} と比較して約 2 倍もの研究開発費を投じています。海外競合企業の売上高研究開発費率も 14.6 %^{※3} となっており研究開発費比率が非常に高い産業と言えます。

こうした当産業における研究開発費の状況とその果たす役割を踏まえて、次の措置を要望します。

※1 当協会の 2021 年 9 月調査による SEAJ 会員企業主要 14 社の 2016~2020 年度の 5 年間の平均

※2 出所：経済産業省「令和元年企業活動基本調査確報（平成 30 年度実績）」

※3 当協会の 2021 年 9 月調査による海外競合企業主要 5 社の 2016~2020 年度の 5 年間の平均

(1) 半導体投資促進税制の導入

今般、製造装置を含む半導体業界を取り巻く環境は、自国の半導体製造キャパシティの強化やサプライチェーンの確保を目的とした政策が各国から公表され、当産業の重要性を強く意識した優遇制度が次々と打ち出される状況にあります。国家を挙げて後押しを受ける諸外国企業との競争においては、本国企業にとってもそれら諸外国と同程度の税制面での環境が必要不可欠な状況となっております。また当産業における本国企業の優位性は、企業が独自に培った技術力のみならず、高度な技術力を持った関連分野の企業が本国内に多数存在することにも起因するため、製造装置を含む半導体産業全体の強化を図ることが重要となります。

つきましては、当産業が国際社会において引き続き競争力を発揮するには企業の積極的な設備投資が不可欠なため、製造装置を含む半導体関連企業が実施する設備投資に関して、概ね 20%程度の税額控除が可能となる新たな優遇制度を要望します。

さらに当産業における研究開発は、当産業の成長の根幹であるのみならず国家の成長を支える重要な投資でもあるため、製造装置を含む半導体関連企業が実施する研究開発に関して、研究開発費の増加割合に応じてではなく単純に総額に対して概ね 40%から 50%程度の税額控除が可能となる新たな優遇制度を要望します。また税額控除の限度額がキャップとなることがないよう、控除限度額については撤廃、もしくは十分に緩和された控除限度額（例えば法人税額の 50%超）が一体となった制度となることを合わせて要望します。もしくは、最低限度の税率（例えば 15%程度）を定め、当最低限度の税率までは税額控除が可能となるような制度を要望しま

す。

(2) 試験研究費の税額控除割合の拡大及び税額控除限度額の廃止

当産業の研究開発費が多大であること、それによってもたらされる産業全体の成長とイノベーションが国益にもたらす影響を踏まえ、現在の試験研究費の税額控除制度における税額控除割合の拡大と控除限度額の廃止を同時に実現することを要望します。当産業の税額控除限度額の切捨て額は131億円^{※4}にのぼり、これは当産業の法人税額1,256億円^{※5}の約10%に相当する額となります。

上記の通り、法人税額に対する税額控除の割合は十分な割合とは言えないため、さらなる税額控除割合の拡大並びに税額控除限度枠のさらなる引き上げ、更には限度枠の廃止を要望します。加えて、研究開発税制は成長戦略の重要な政策税制であるため、租税特別措置法による時限的措置ではなく、本来、本則化による恒久的措置とすべきと考えます。

※4 当協会の2021年9月調査によるSEAJ会員企業主要14社の2016～2020年度の5年間の平均

※5 当協会の2021年9月調査によるSEAJ会員企業主要14社の2016～2020年度の5年間の平均

(3) 繰越税額控除限度超過額等の繰越期間の復活及び繰越税額控除要件の廃止

当産業の業績は、顧客である半導体・FPDメーカーの急激な投資動向の変化による振れ幅が大きく、かつそのサイクルも長期にわたるケースが多くあります。平成27年度に廃止された試験研究費の税額控除制度におきましては、繰越税額控除限度超過額がある場合、一定期間に限ってのみ繰越控除が認められていましたが、廃止された現行制度下においては、超過額に対する恩恵を受けることができなくなっております。また、廃止前の制度の下であっても、当該事業年度に所得がないために本制度の恩恵を受けられないケースが生じておりました。

つきましては、まずは本制度の復活を要望します。加えて、諸外国の同制度が主に複数年～無期限であることに鑑み、繰越税額控除限度超過額等の繰越期間を無期限とし、併せて繰越控除を行う際の従来控除要件は廃止することを要望します。

(4) サービス開発税制の拡充及び自社利用ソフトウェアの開発費用の扱いについて

サービス開発税制において、例えばセンサーの設置等を行う補助者の人件費に関しては税務上の試験研究費の対象範囲に含まれないとされておりますが、これらの作業は開発過程において必須であるケースが多いことを鑑み、補助者に係る人件費についても試験研究費の対象範囲に含めることとするよう要望します。

また、令和3年度税制改正において税務上の試験研究費の範囲が拡大され、自社利用目的のソフトウェアにかかる研究開発費についても税務上の試験研究費に含まれることとされましたが、一方かかる研究開発費の所得計算上の扱いは、従前通り資産計上が求められており、会計上の扱いと税務上の扱いに乖離が生じたままとなっております。税務上のみにフォーカスした場合でも、同一の研究開発費に対して税額控除計算上は試験研究費として認める一方で、所得計算上は資産計上が

求められており疑問が残る制度設計となっております。この点について、所得計算上においても費用性を認めることとし、全体として整合のとれた税制となることを要望します。

(5) イノベーションボックス税制の創設

研究開発の成果である特許などの知的財産に基づく所得を減税対象とするイノベーションボックス税制が欧州を中心に普及し始めています。

既に EU においては、英国、オランダ、フランス等 7 カ国が、アジアにおいては中国がイノベーションの促進及び競争力向上を目的として、研究開発の成果である知的財産権から生じる所得に対する税率を優遇するイノベーションボックスまたはパテントボックス税制を導入しています。

一例として本税制を積極的に導入・推進するオランダでは、2004 年に 29.0%であった法人税率を 2011 年までに段階的に 25.0%に引き下げる措置と併せて、2010 年に従来のパテントボックス税制をイノベーションボックス税制へと拡大しています。オランダに限れば研究開発活動による知的財産から生じた所得のみならず、R&D の機能に帰属する全ての所得に対してイノベーションボックス税制が適用される仕組みとなっており、更にこの適用を受けた場合に当該所得に適用される実効税率は 7~9%と大変低い税率となるため、研究開発型の企業にとっては大変大きな恩恵を受ける税制が敷かれております。

同国に本社を置く半導体製造装置のメーカーである ASML 社の 2016 年度から 2020 年度の法人税率は平均 11.0%と極めて低く^{※6}、イノベーションボックス税制の恩恵を最大限受けております。

海外企業と同じビジネス環境で熾烈な競争を戦えるよう、わが国においてもイノベーションボックス税制をできる限り早期に導入することを要望します。

※6 ASML 社決算報告書による 2016~2020 年度の 5 年間の平均

2. 法人実効税率の引下げ

わが国の法人実効税率は、平成 28 年度税制改正により平成 27 年度の 33.06%から、平成 28 年度及び平成 29 年度は 30.86%、平成 30 年度以降は 30.62%へ引き下げられました^{※7}、依然として欧州及びアジア諸国に比べて高い水準にあります。

また、法人税率の引き下げが実施されている一方、平成 28 年度税制改正において地方税である外形標準課税は税率の引き上げが実施され、外形標準課税の割合が大きい企業や赤字企業等においては法人事業税が実質増税となる企業も少なからずあるのも事実です。

わが国と事業及び立地において競争関係にあるアジア諸国と比較すると、中国 25%、韓国 25%、台湾 20%、シンガポール 17%と 5~10%以上の乖離があり、日本の企業競争力及び立地競争力低下の大きな要因になっており、世界で戦う日本企業が継続的に存続することは困難です。

立地競争力強化のためには、空港・港湾等の産業インフラの整備、金融・資本市場の活性化、雇用制度の改革、人材強化等の総合的な施策が必要ですが、法人実効税率の引き下げの果たす役割は特に重要です。

従って、現在懸念されている「根こそぎ空洞化」を防止するに留まらず、より積極的に海外の成長力ある企業がわが国を拠点とした事業活動を行うことを希求する水準への思い切った引き下げが必要です。

具体的には、法人実効税率をアジア諸国と競争力のある水準である 20%前半まで、3 年以内に引き下げること及び外形標準の税率を改正前に戻すことを要望します。

※7 超過税率適用法人の場合（東京都の超過税率で算定した税率）

3. 欠損金の控除限度額の撤廃及び繰越期間の無期限化

法人税における繰越欠損金の控除制度は、単一年度課税の欠点を是正し、事業年度ごとの課税負担の平準化を通じて経営の中長期的な安定性を確保する上でも極めて重要な制度と考えています。

当産業の特徴として、顧客である半導体・FPD メーカーの投資動向の影響を受けやすく業績の変動が激しいため、景気後退期には比較的大きな損失を計上する傾向があり、繰越欠損金については十分な措置を設ける必要があります。

しかしながら、わが国の繰越欠損金に関する制度は、控除額は当期所得の 50%、繰越期間も 10 年と制限が課され、諸外国に比べても見劣りのする内容でグローバル企業と熾烈な競争を続けている当産業にとっても国際競争力維持の観点からも障害となっております。

つきましては、繰越欠損金の控除限度額を撤廃した上で繰越期間を無期限とすることを要望致します。

4. 設備投資に関する減税及び資産課税制度の見直し

(1) 設備投資に関する減税

製造装置を含む半導体業界は、高度な技術を要した生産性の高い産業であるとともにわが国に残された数少ない国際競争力のある産業であります。また、2050 年カーボンニュートラル実現に向けた産業政策としてグリーン成長戦略に定められた産業の成長には最先端の半導体（ロジック、メモリ、パワーなど）の提供が必須であり、極めて重要な分野であります。つきましては、本要望書の 1. (1)「半導体投資促進税制の導入」に記載しておりますとおり製造装置を含む半導体関連企業が実施する設備投資に関して、概ね 20%程度の税額控除が可能となる新たな優遇制度の創設を重ねてお願いいたします。

また、国内の先端産業は、海外企業との熾烈な競争に勝ち残るため、世界最高レベルの技術水準を維持し、同時にグリーン・イノベーションの推進、さらにはウィズ・コロナの時代にも対応しながら貢献していくことが求められます。このような状況

において、多くの企業が設備投資に関する優遇税制が受けられるように、平成 29 年 3 月末に廃止となった旧制度「生産性向上設備投資促進税制」の復活を希望致します。

令和 3 年度に創設されました DX（デジタルトランスフォーメーション）投資促進税制は、2 年間の時限措置であるにもかかわらず極めて高い認定要件が必要となっております。わが国のデジタル化を加速するため適用および申請条件の緩和を要望いたします。

近年わが国では、豪雨、地震、津波などの自然災害による甚大な被害が多発しており、事前対策の強化が求められています。これらに関連した設備投資に対する「中小企業防災・減災投資促進税制」が創設されておりますが、税額控除の適用はなく特別償却のみであり、取得前に計画の策定や認定を受ける必要があるなど使いづらい制度となっております。つきましては、手続きの簡素化や対象資産ならびに税制措置の拡充を希望いたします。

(2) 固定資産税（償却資産）の見直し

わが国における償却資産に関わる固定資産税について、国際的に見ても稀な制度であること、業種間での税負担に偏在があるなどの問題点を踏まえ、速やかな縮減と廃止を要望します。少なくとも、耐用年数の短い動産は、原材料・水道光熱費等の経費と同様、製品・部品を製造するために費消される投入原価要素であり、固定資産税の課税対象にはなじまないことから、課税対象から除外すべきと考えます。

償却資産にかかる固定資産税の申告には法人税の償却計算とは別に評価額の算出を要します。法人税と同一の償却計算にすることで申告作業の効率化に繋がっていただきますよう制度の見直しをお願いいたします。

また、圧縮記帳・特別償却・割増償却など国税の申告では認められる制度が固定資産税（償却資産）では認められない、また、一括償却資産は固定資産税（償却資産）の対象外となるにもかかわらず少額減価償却資産は対象となるなど、国税においては民間投資の刺激を目的とした税務上の恩典があるにもかかわらず、地方税においては税収の確保だけに重きを置いているように見受けられます。グローバル競争に勝ち抜いてゆくためにも、国だけでなく地方単位での優遇税制の実施を強く望みます。

5. 国際関連税制の見直し

(1) 移転価格税制の改善

移転価格調査の課税手法は取引単位営業利益法（TNMM）が一般的であるが、明確な数値が無く、企業側は法令違反を行っている訳では無いのに、当局による移転価格課税が行われる例が多くみられます。つきましては、国別業種別等の具体的な数値・基準等を法令等で明記して頂く事を要望します。

(2) 外国税額控除の条件緩和

企業活動がグローバルに展開される中で、二重課税の排除は可能な限り許容されるべきであります。当産業の企業の多くは海外に現地法人を設立し当該国/地域で活動を展開しておりますが、技術進歩が速いため国内からの人員派遣や設備貸与が不可欠となっております。日本企業がこれらの活動を通して現地で得る役務所得や設備使用料等は現地で源泉徴収課税された後に、現地法人や顧客から回収されますが、これら外国での課税額についての日本での外国税額控除の条件を見直し緩和することにより、企業のグローバルな活動促進が期待されます。

現行税制で3年間となっている控除限度超過額と控除余裕額の繰越期間を延長するとともに、繰越期間経過後の控除限度超過額を損金算入可能とする条件緩和により、二重課税の排除が拡大されることを要望します。

6. オープンイノベーション促進税制の継続と見直し

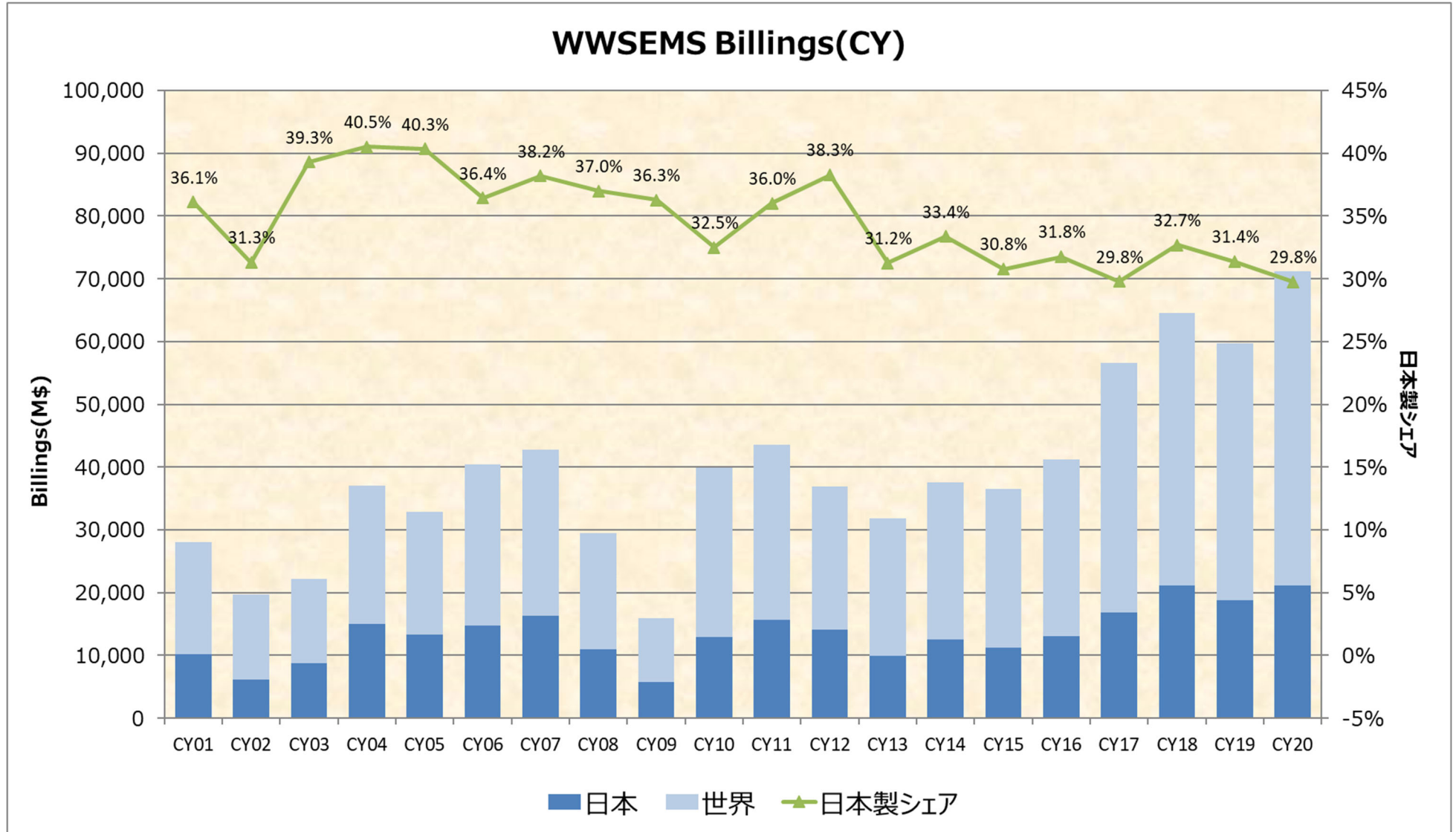
2020年4月に創設されたオープンイノベーション促進税制は、2022年3月31日までとされておりますが、有益な制度であり、2022年4月以降も制度の継続を要望します。

現行制度では、資本金の増加を伴う出資のみが適用対象ですが、既発行株式の取得でも対象に含めることを要望します。また、より深いシナジーが期待されるスタートアップ企業に対する既発行株式の取得を含むM&Aを行う場合においても、対象とするよう要望します。

以 上

<添付資料1>

1. 半導体製造装置世界市場と日本製装置シェア推移

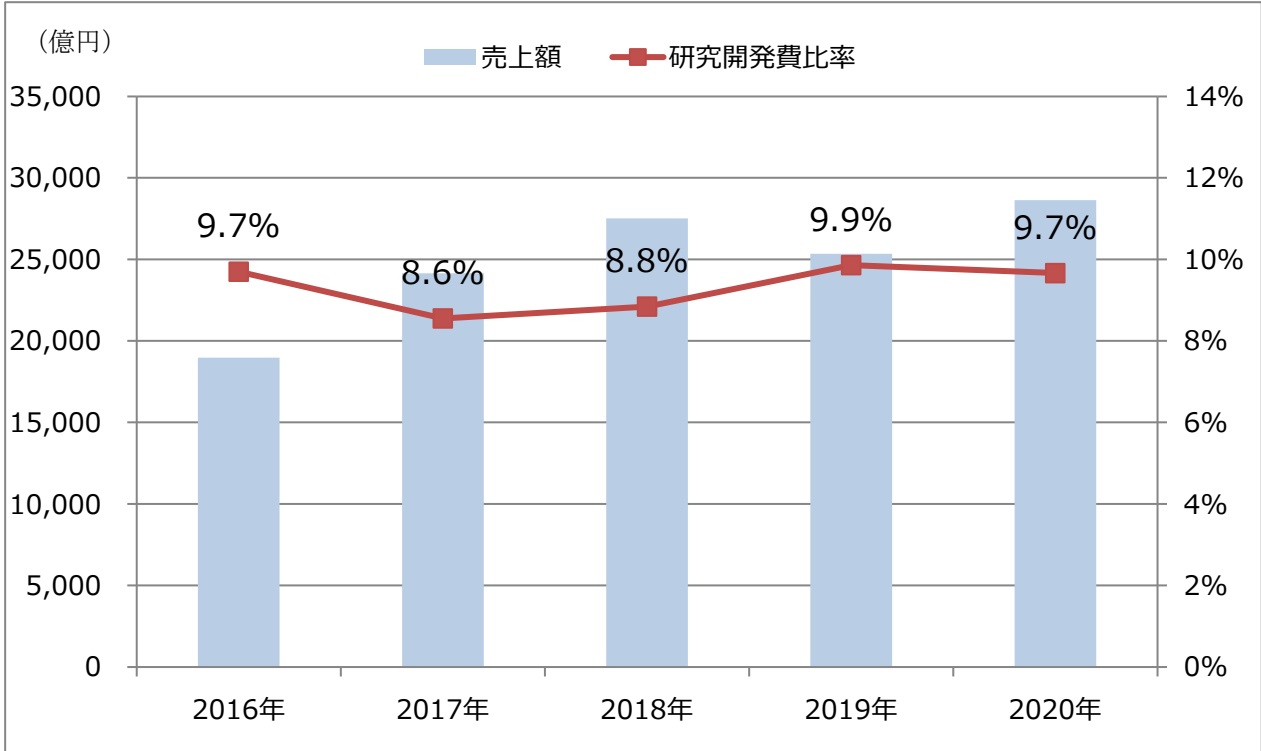


＜添付資料2＞

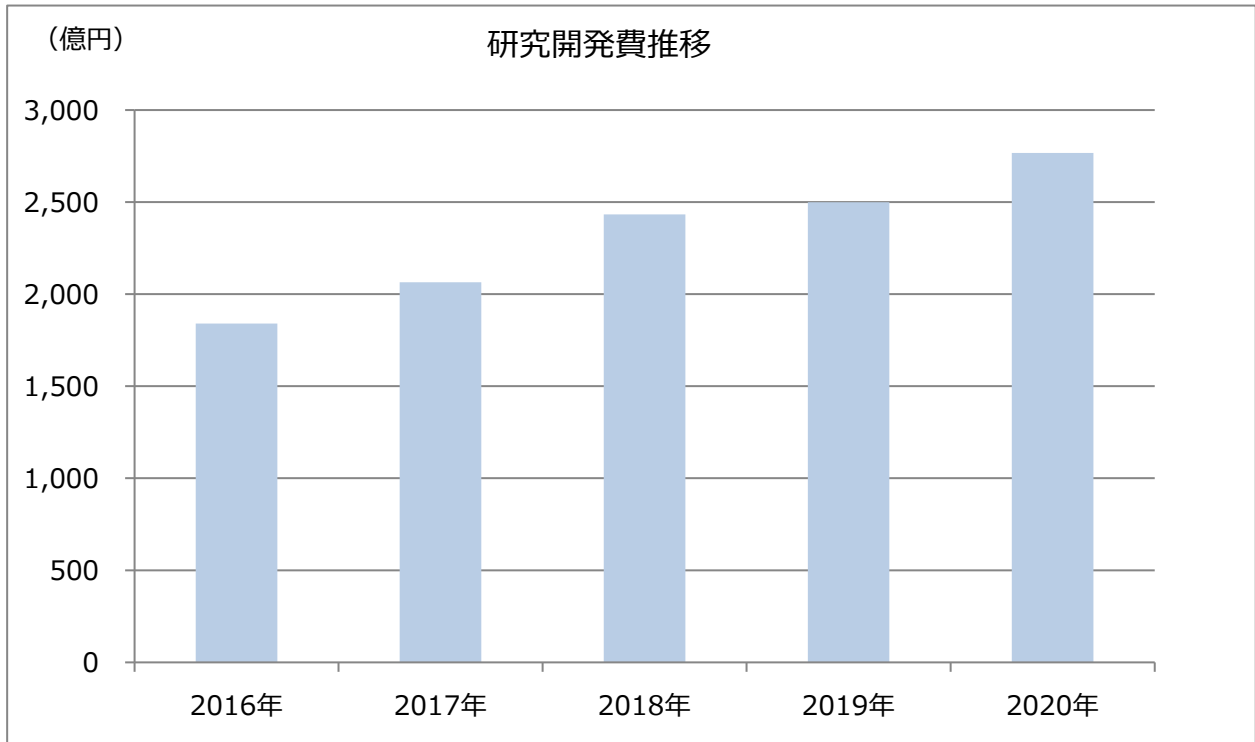
2. 売上高研究開発費(事業)及び、設備投資(事業)比率

1) SEAJ 会員企業 (主要 14 社合計)

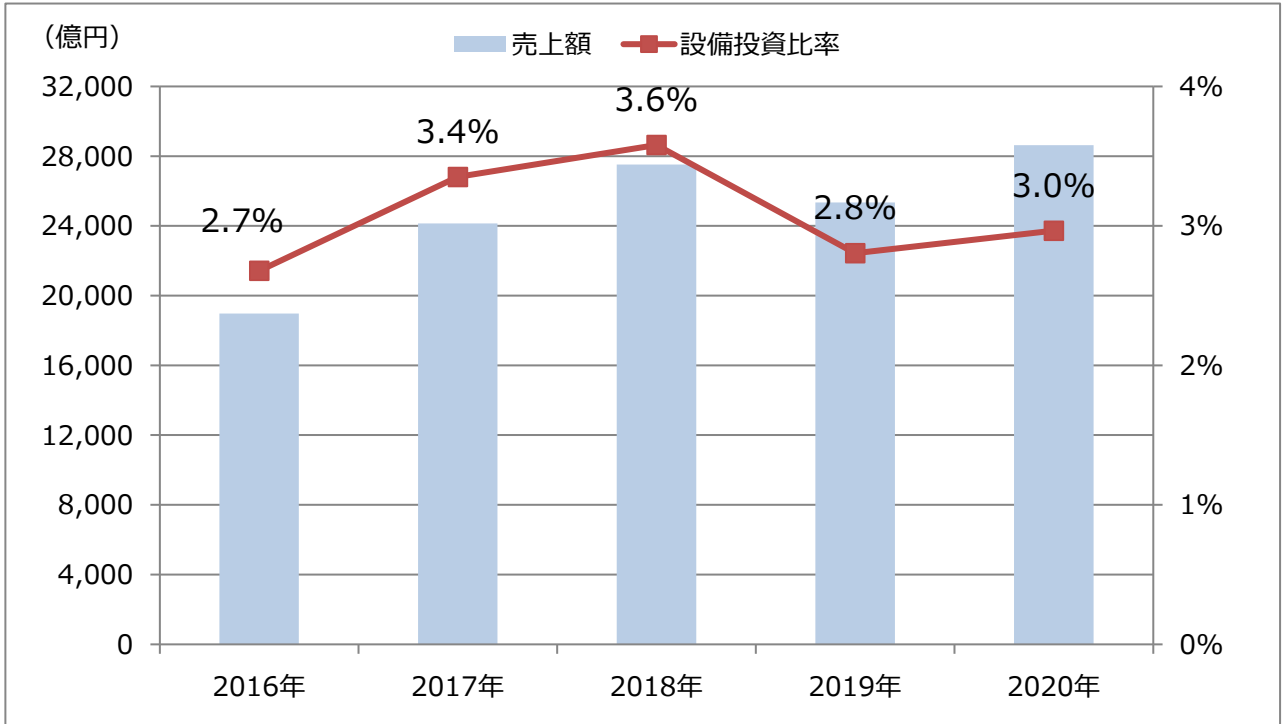
＜売上高研究開発費 (事業) 比率 (主要 14 社合計) ＞



＜研究開発費(事業)推移 (主要 14 社合計) ＞

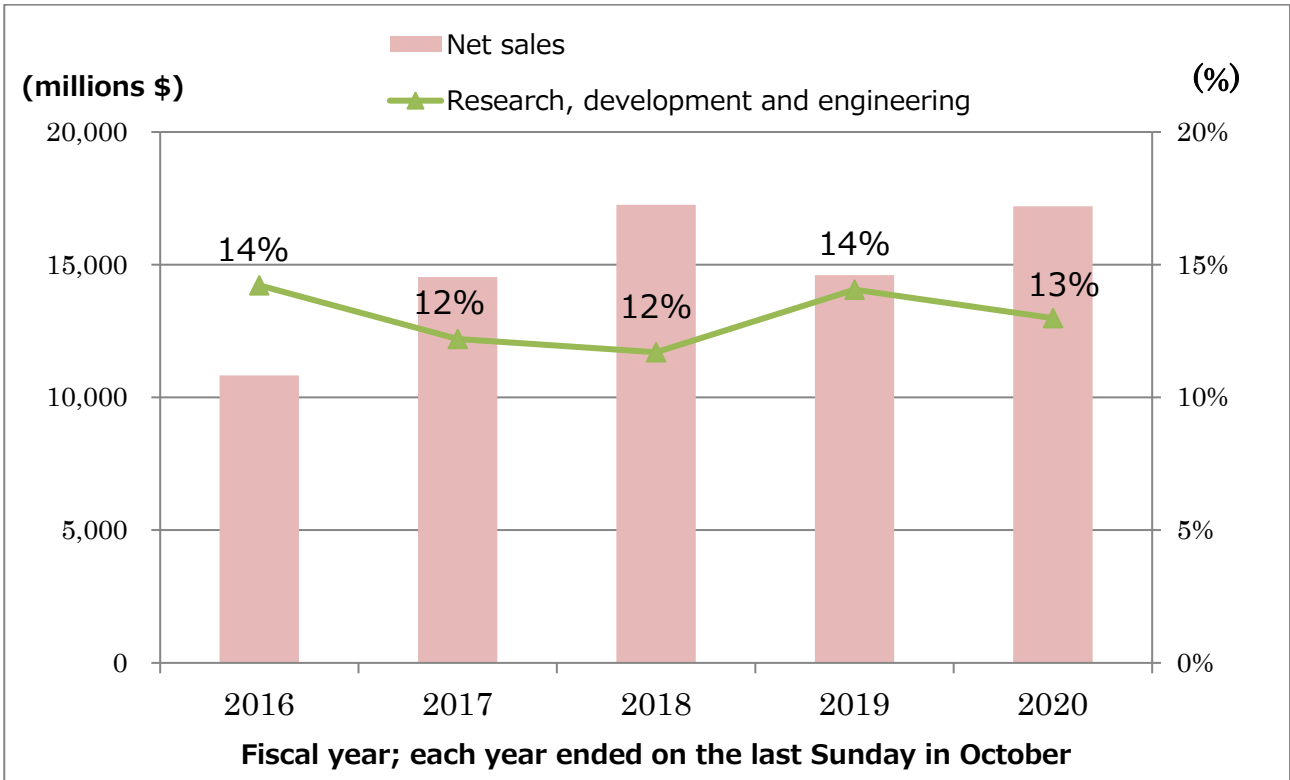


＜売上高設備投資(事業)比率（主要14社合計）＞

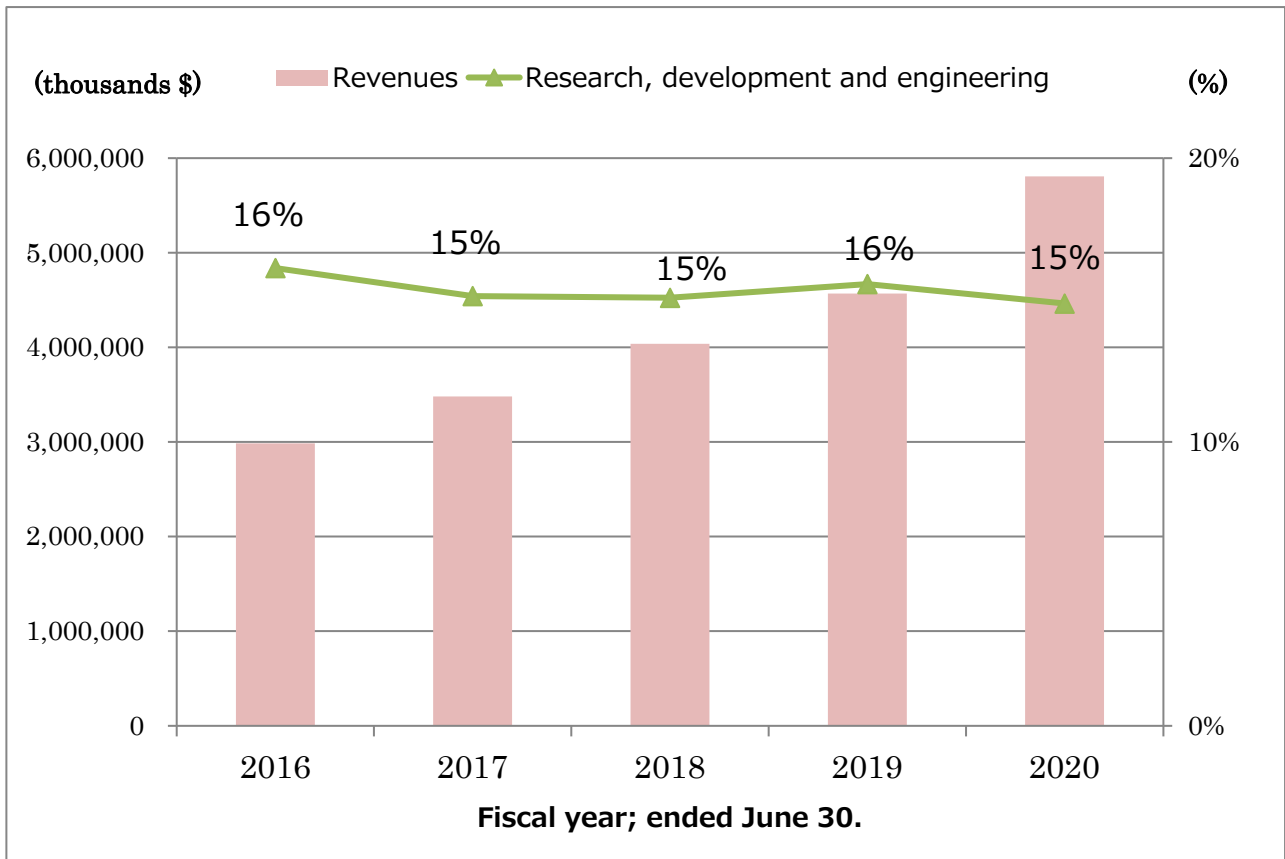


2) 海外競合企業（売上高研究開発費比率）

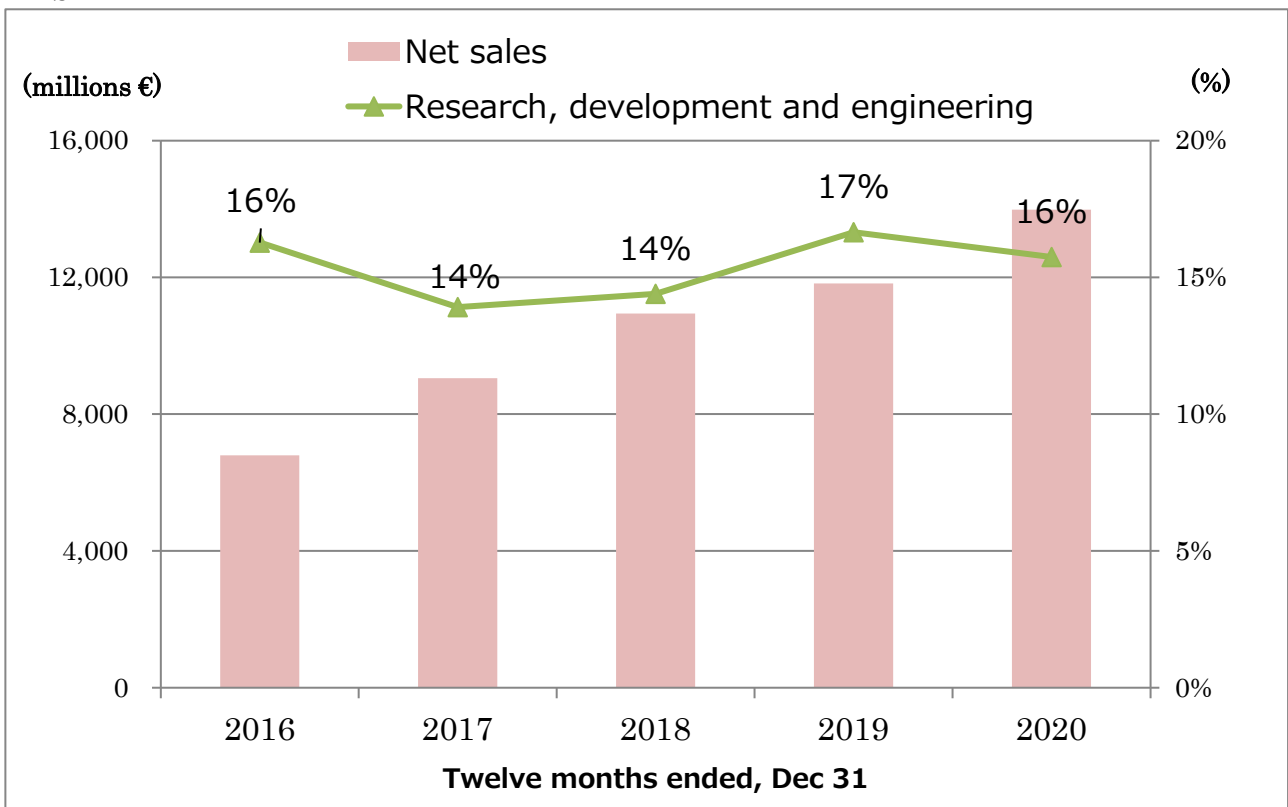
＜AMAT＞



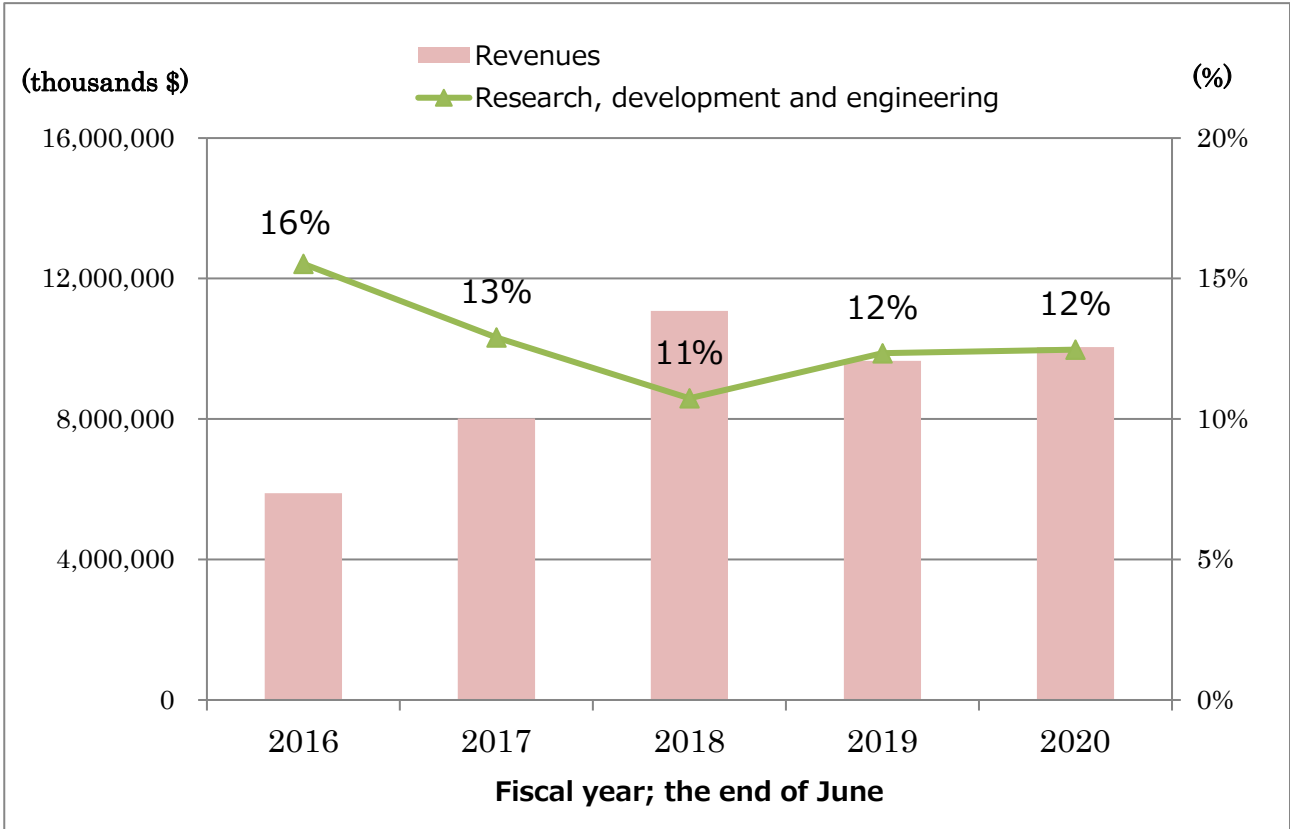
＜KLA-Tencor＞



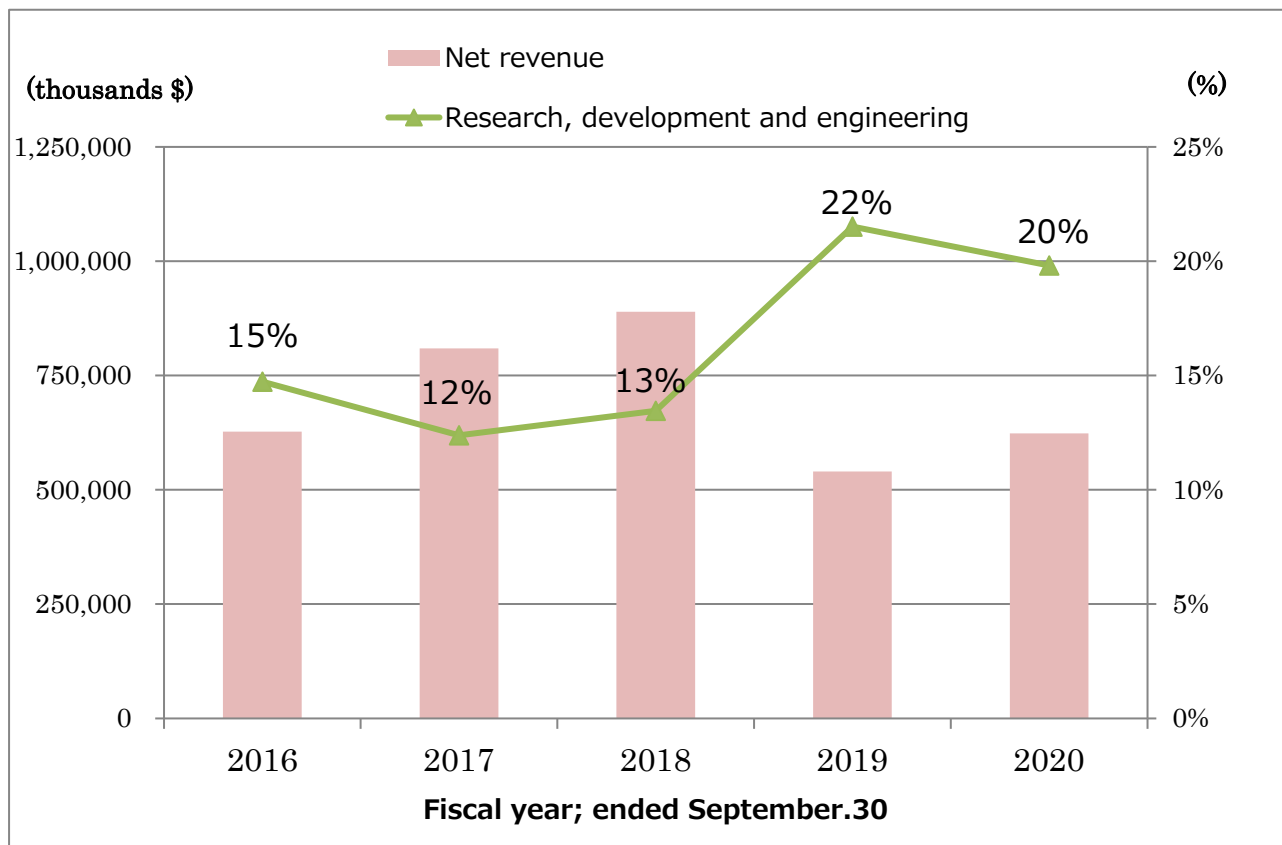
＜ASML＞



<Lam-Research>



<Kulicke & Soffa>



3) ASML 社法人税率推移 (2016年度～2020年度 平均 11.0%)

ASML(€ in millions)	2016	2017	2018	2019	2020
Net sales	6,795	9,053	10,944	11,820	13,979
Gross profit	3,044	4,077	5,029	5,280	6,797
R&D costs, net of credits	1,106	1,260	1,576	1,969	2,201
Selling, general and administrative	375	417	488	521	545
Income (loss) from operations	1,658	2,496	2,965	2,791	4,052
Income(loss) before income taxes	1,691	2,446	2,937	2,766	4,017
Provision for income taxes	219	327	345	174	463
Net income(loss)	1,472	2,119	2,592	2,592	3,554
法人税率	13.0%	13.4%	11.8%	6.3%	11.5%

4) AMAT 社法人税率推移 (2016年度～2020年度 平均 17.2%)

AMAT (millions \$)	2016	2017	2018	2019	2020
Net sales	10,825	14,537	17,253	14,608	17,202
Gross profit	4,511	6,532	7,817	6,368	7,692
R&D costs, net of credits	1,540	1,774	2,019	2,054	2,234
Selling, general and administrative	819	890	1,002	982	1,093
Income (loss) from operations	2,152	3,868	4,796	3,350	4,365
Income(loss) before income taxes	2,013	3,731	4,694	3,269	4,166
Provision for income taxes	292	297	1,381	563	547
Net income(loss)	1,721	3,434	3,313	2,706	3,619
法人税率	14.5%	8.0%	29.4%	17.2%	13.1%

5) 控除税枠切捨て額、繰越切捨て額 (SEAJ 会員企業主要 14 社合計)

(M¥)

	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年
売上額(全社)	6,609,705	7,958,680	8,104,693	7,432,451	7,065,993
研究開発費(会計上)	545,902	597,911	615,854	606,151	593,670
研究開発費(税務上)	449,054	438,001	462,814	482,136	481,151
法人税額	88,700	168,569	156,679	101,071	113,131
控除税額	18,730	35,983	38,797	25,197	28,026
税枠切捨て額	21,897	9,003	4,459	15,376	14,860

(注) 上記表に記載されている税務上の研究開発費、法人税額など税務上に関わる数値は法人税の別表を基に記載しています。

6) 日本主要産業別研究開発費

(出所：経済産業省「2020年企業活動基本調査確報－2019年度実績－」)

	研究開発費 報告企業数	売上高 (百万円)	研究開発費 (百万円)	売上高研究 開発費比率 (%)	受託研究費 (百万円)	1 企業当たり(百万円)	
						売上高	研究開発費
合 計	8,246	361,803,716	14,984,524	4.1	1,160,942	43,876	1,817
製造業	6,086	234,557,073	11,922,450	5.1	289,832	38,540	1,959
電気・ガス業	36	22,975,505	131,926	0.6	8,890	638,208	3,665
情報通信業	609	17,976,591	719,844	4.0	47,136	29,518	1,182
卸売業	995	74,233,490	1,396,154	1.9	67,864	74,607	1,403
小売業	144	3,287,923	21,744	0.7	67	22,833	151
サービス業 (*)	126	X	X	X	14,450	X	X

(*) その他のサービス業を除く

(注) 売上高研究開発費比率=研究開発費/研究開発報告企業売上高×100

太字数値は、経済産業省企業活動基本調査 統計表一覧－確報(データ) 2020年企業活動基本調査確報－2019年度実績－ 「第1巻 [研究開発に関する表] 第10表 産業別、企業数、売上高、研究開発費及び売上高比率、受託研究費、研究開発投資、能力開発費」より

7) 半導体・FPD 製造装置の設備投資額、償却資産残高推移

SEAJ 会員企業 (主要 14 社合計)

(M¥)

	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年
設備投資額(事業)	50,811	80,899	98,522	71,077	84,901
償却資産残高(機械設備等)	134,830	153,272	184,956	199,529	225,016